

COMPOL®

Silicon & Exotic
Material Polish



COMPOL

COMPOLは、LiTaO₃、LiNbO₃、サファイア等の電子材料基盤、金属材料及びセラミックスのポリシング専用開発された高純度コロイダルシリカスラリーです。粒子の均一性、分散性に優れ、高効率でダメージフリーの研磨面が得られます。

COMPOL-50AD、COMPOL-50Sは、コロイダルシリカスラリーに特殊有機アミンをバランス良く配合したシリコン専用高効率一次及び二次ポリシング材です。

COMPOL

COMPOL is a colloidal silica slurry developed especially for polishing metals, ceramics and electronic substrates such as LiTaO₃, LiNbO₃ and sapphire. With excellent particle uniformity and dispersal, it delivers high-removal rate, damage free polishing. COMPOL-50AD and COMPOL-50S combine colloidal silica slurry with special organic amines, specifically designed for high-removal rate primary and secondary polishing of silicon wafer. Even when used at high dilutions, COMPOL delivers excellent processing efficiency and long slurry life.

COMPOLの代表的物性 Typical Physical Properties of COMPOL

製品名 Type	20	50	80	120
項目 Item				
SiO ₂ 量 Content of SiO ₂ (%)	40	40	40	40
pH	9.2	10.2	10.2	9.2
比重 Specific gravity	1.30	1.30	1.30	1.30
平均粒子径 Average particle size (nm)	15.0	40.0	72.0	82.5
標準入数 Standard Net weight	20kg	20kg	20kg, 260kg	20kg

用途:サファイア、CaF₂、BGO、LiTaO₃、LiNbO₃その他の酸化物結晶
applications:sapphire, CaF₂, BGO, LiTaO₃, LiNbO₃ and other oxide crystals

製品名 Type	EX- II	EX-3
項目 Item		
SiO ₂ 量 Content of SiO ₂ (%)	30	50
pH	9.8	9.5
比重 Specific gravity	1.205	1.385
平均粒子径 Average particle size (nm)	51.0	32.5
標準入数 Standard Net weight	18kg, 240kg	20kg

用途:サファイア、CaF₂、BGO、LiTaO₃、LiNbO₃その他の酸化物結晶
applications:sapphire, CaF₂, BGO, LiTaO₃, LiNbO₃ and other oxide crystals

製品名 Type	50S	50AD
項目 Item		
SiO ₂ 量 Content of SiO ₂ (%)	50	50
pH	11.0	11.0
比重 Specific gravity	1.375	1.375
平均粒子径 Average particle size (nm)	35.0	30.0
標準入数 Standard Net weight	20kg	20kg, 280kg

シリコンウエファァーの一次、二次用ポリシング
applications:primary and secondary polishing of Si wafer